セミクリーンシリーズ
プロダクトリスト

- フラットパネルディスプレイ、タッチパネル用
- 電子、半導体部品用
- 光学部品用
- メンテナンス用

● フラットパネルディスプレイ、タッチパネル用

◆ガラス・成膜基板洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長（無機アルカリタイプ）
L.G.L	常温～60℃	1～5%	11.7（2%）	特殊キレート剤、特殊界面活性剤を配合し高い洗浄力を発揮。
KG	常温～60℃	1～5%	11.9（2%）	指紋、オイルミストなどの油分を強力に洗浄し、優れたリンス性を発揮。
NA-1	常温～60℃	1～5%	12.2（2%）	成分中にリンを含まず、洗浄剤残渣も簡単に溶解。
MG	常温～60℃	1～5%	12.4（2%）	非常に優れた洗浄力があり、研磨剤、紙ヤケなどを簡単に短時間で除去。
SD	常温～60℃	1～5%	12.5（2%）	高い洗浄力があり、特にパーティクルの除去に最適。
A-1	常温～60℃	2～5%	11.6（2%）	アルミ膜、MAM電極にダメージを与えることなく、優れた洗浄力を発揮。
GE-X	常温～60℃	20%～原液	13以上（原液）	フッ化物、ガラスカレットなどの固着した残渣物を簡単に除去。ライトエッチングに最適。
製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長（有機アルカリタイプ）
LC-2	常温～60℃	2～10%	10.4（10%）	高い洗浄力があり、TFT用ガラス基板の受入洗浄に最適。
MF-2	常温～60℃	1～10%	12.0（2%）	成膜時、膜の密着性が向上。TFT用ガラス基板の成膜前洗浄に最適。
製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長（中性タイプ）
M-LX	常温～60℃	1～10%	7.0（原液）	非イオン界面活性剤、キレート剤併用の低泡洗浄剤。パーティクルの除去に最適。加温洗浄が可能。
M-LO	常温～40℃	1～10%	6.0（原液）	非イオンタイプ。低泡性でブラシ洗浄に使用可能。イオン性物質非含有。
M-4	常温～40℃	1～10%	8.4（原液）	非イオンタイプ。洗浄力に優れ、特に油分に対して強力な洗浄力を発揮。
製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長（酸性タイプ）
DS-S	常温～60℃	1～10%	1.7（1%）	有機酸を使用し、研磨剤、ガラスカレットを強力に除去。

◆レジスト現像液

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
DL-A4	常温～40℃	5～10%	11.5（原液）	レジスト溶解力が高い無機アルカリタイプ。短時間でレジスト除去が可能。
DL-A9C	常温～40℃	1～5%	12.3（2%）	無機アルカリ強力タイプ。特殊成分配合によりシャープな現像が可能。
DL-A10	常温～40℃	1～5%	12.1（2%）	無機アルカリ強力タイプ。非常に優れた現像力を発揮。
DL-P1	常温～40℃	10～30%	12.6（20%）	アルミ対応の無機アルカリタイプ。レジスト溶解力が高い。
DL-T25	常温～60℃	5～20%	12.7（5%）	金属イオンを含まない有機アルカリタイプ。

◆レジスト剥離剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
EP-10	常温～60℃	原液	12.5（原液）	高いレジスト剥離力。洗浄装置及びCFタンクの洗浄に使用可能。
OT	常温～60℃	原液	8.5（原液）	金属部材へのダメージを与えることなく、短時間でレジスト剥離が可能。

◆クロムエッチャント液

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
ファイン・エッチ	常温～50℃	原液	2以下（原液）	エッチングレートが高く、長時間使用が可能。

◆液晶洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
FC-10	常温～50℃	原液	中性（原液）	準水系タイプ。液晶溶解力が非常に高く、優れた洗浄力を発揮。
FC-40	常温～50℃	原液	7.8（原液）	水系タイプ。超音波効率が良く、狭ギャップでも高い洗浄力を発揮。
FC-54	常温～50℃	原液	中性（原液）	準水系タイプ。液晶セル洗浄のほか治具洗浄にも使用可能。

◆樹脂剥離剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
CR-2	常温～40℃	5～20%	13.0（5%）	希釈して使用するためランニングコストを軽減。無泡性タイプ。
EP-5	常温～60℃	原液	13以上（原液）	準水系タイプ。PI配向膜を短時間で剥離。感光性樹脂製版洗浄にも対応。
DF-7	常温～60℃	原液	13以上（原液）	水系タイプ。カラーフィルターに対して剥離力が強く、浸漬剥離に最適。

◆ラビング後洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
RB-1	常温～60℃	5%	中性（原液）	ラビングで生じるパーティクルを除去。特に優れたリンス性を発揮。

● 電子、半導体部品用

◆脱脂洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　　長
NC	常温～40℃	2～10%	10.7（5%）	研磨剤や切削油などの汚れを強力に除去。幅広い材質に使用可能。
M-4	常温～40℃	1～10%	8.4（原液）	シリコンオイルや加工油などの除去に最適。搬送ケースなどの洗浄に使用可能。

●光学部品用

【フォトマスク関連】

◆ガラス・石英・金属洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
L.G.L	常温～60℃	1～5%	11.7(2%)	ガラス、Cr膜などあらゆる洗浄対象に対応。
NA-1	常温～60℃	1～5%	12.2(2%)	成膜前の洗浄により、膜の密着性向上が可能。
SD	常温～60℃	1～5%	12.5(2%)	強力な洗浄力により、研磨剤などを短時間で除去可能。
NC	常温～40℃	2～10%	10.7(5%)	メタルマスクの脱脂に優れた洗浄力を発揮。
LC-2	常温～60℃	2～10%	10.4(10%)	メタルフリータイプ。Cr膜面の洗浄に最適。

◆レジスト現像液

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
DL-A9C	常温～40℃	1～5%	12.3(2%)	無機アルカリ強力タイプ。特殊成分配合によりシャープな現像が可能。
DL-A10	常温～40℃	1～5%	12.1(2%)	無機アルカリ強力タイプ。非常に優れた現像力を発揮。
DL-P1	常温～40℃	10～30%	12.6(20%)	アルミ対応の無機アルカリタイプ。レジスト溶解力が高い。
DL-T25	常温～60℃	5～20%	12.7(5%)	金属イオンを含まない有機アルカリタイプ。

◆レジスト剥離剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
EP-10	常温～60℃	原液	12.5(原液)	高い剥離力により短時間でレジスト除去が可能。
OT	常温～60℃	原液	8.5(原液)	金属部材へのダメージを与えることなくレジスト剥離が可能。

◆クロムエッチャント液

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
ファイン・エッチ	常温～50℃	原液	2以下(原液)	パターン形成だけでなく、マスクリペアの脱膜に最適。

【レンズ関連】

◆ガラス・軟硝材・プラスチック洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
KG	常温～60℃	1～5%	11.9(2%)	レンズ加工後の脱脂、パーティクル除去に最適。
NC	常温～60℃	2～10%	10.7(5%)	成膜前の洗浄により、膜の密着性、成膜不良の改善が可能。
LC-2	常温～60℃	2～10%	10.4(10%)	ピッチ、ワックスなどの残渣除去に最適。一部軟硝材にも対応。
NC-211H	常温～40℃	4～20%	10.6(6%)	軟硝材へダメージを与えることなく研磨剤、油分などを強力に除去。
GE-X	常温～60℃	20%～原液	13以上(原液)	研磨ヤケ、紙ヤケの除去だけでなく、ダイシング用仮固定ワックスの除去にも使用可能。
ZA-2	常温～40℃	原液	7.6(原液)	芯取油などの加工油の脱脂に最適。油分離型なので長期間使用可能。

◆加工用樹脂剥離剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
GC	常温～60℃	原液	中性(原液)	レンズ研磨後のピッチ、蜜蝋、保護膜を短時間で除去可能。
GC-K27	常温～60℃	原液	9.5(原液)	弱アルカリタイプ。接着剤、ワックスなどの除去に最適。
WR	常温～60℃	原液	中性(原液)	各種仮固定ワックスやインクの除去が可能。リンス時の再付着防止効果が高い。
DF-7	常温～60℃	原液	13以上(原液)	金型、モールドに付着した樹脂残渣を短時間で除去可能。

◆湿潤保持剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
TM-4	常温	原液	7.3(原液)	レンズ、基板に付着した研磨剤の乾燥防止、湿潤保持に使用可能。

● メンテナンス用

◆塗料・インキ・スクリーン版洗浄剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
OT-S	常温～60℃	原液	7.5(原液)	硬化、未硬化を問わず塗料・インクを除去可能。調合設備の定期メンテに最適。
OT	常温～60℃	原液	8.5(原液)	銀、ガラスペーストの洗浄に最適。蛍光体も短時間で除去。
GC	常温～60℃	原液	中性(原液)	シール材や糊残渣を除去可能。

◆消泡剤

製品名	使用温度	使用濃度	pH	特　長
EL-70	常温～30℃	500ppm～	4.5(原液)	ノンシリコンタイプの消泡剤。現像・リンス工程での消泡に最適。

※別途メンテナンス用にゼロクリーン/ライフクリーンシリーズがございます。

横浜油脂工業株式会社
精密洗浄剤事業部

〒220-0074　横浜市西区南浅間町1-1
TEL　045-313-8255(直通)
FAX　045-314-2026
https://www.yof-linda.co.jp

2023.07